

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年2月3日 (03.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/010968 A1

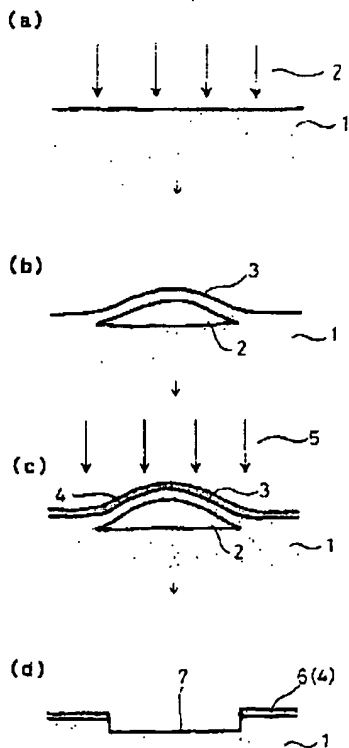
- (51) 国際特許分類: H01L 21/3065 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/011025 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 五十嵐 慎一
(22) 国際出願日: 2004年7月27日 (27.07.2004) (IGARASHI, Shinichi) [JP/JP]; 〒305-0047 茨城県つく
(25) 国際出願の言語: 日本語 ば市千現1丁目2番1号 独立行政法人物質・材料研
(26) 国際公開の言語: 日本語 究機構内 Ibaraki (JP). 中村 明子 (NAKAMURA, Akiko)
(30) 優先権データ: 特願2003-282196 2003年7月29日 (29.07.2003) JP [JP/JP]; 〒305-0047 茨城県つくば市千現1丁目2番
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立 1号 独立行政法人物質・材料研究機構内 Ibaraki (JP).
行政法人科学技術振興機構 (JAPAN SCIENCE AND 北島 正弘 (KITA, JIMA, Masahiro) [JP/JP]; 〒305-0047
TECHNOLOGY AGENCY) [JP/JP]; 〒332-0012 埼玉 茨城県つくば市千現1丁目2番1号 独立行政法人
県川口市本町4丁目1番8号 Saitama (JP). 独立行政 物質・材料研究機構内 Ibaraki (JP).
法人物質・材料研究機構 (NATIONAL INSTITUTE
FOR MATERIALS SCIENCE) [JP/JP]; 〒305-0047 茨
城県つくば市千現1丁目2番1号 Ibaraki (JP).

- (74) 代理人: 西澤 利夫 (NISHIZAWA, Toshio); 〒107-0062
東京都港区南青山6丁目11番1号 スリーエフ南
青山ビルディング7F Tokyo (JP).
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

/続葉有/

(54) Title: TWO-DIMENSIONAL PATTERNING METHOD, ELECTRONIC DEVICE USING SAME, AND MAGNETIC DE-
VICE FABRICATING METHOD

(54) 発明の名称: 二次元パターニング方法ならびにそれを用いた電子デバイスおよび磁気デバイスの作製方法



(57) Abstract: A novel two-dimensional patterning method enabling two-dimen-
sion patterning without using any photosensitive material and ion milling, wherein
a two-dimensional pattern is formed by destroying a blister provided on a substrate
by electron or ion application.

(57) 要約: 基板上に配置したブリスターを電子照射またはイオン照射に
より破壊することで、二次元パターンを形成し、感光剤やイオンミリン
グを使わない二次元パターニングを可能ならしめる新しい二次元パター
ニング方法とする。

WO 2005/010968 A1



DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。